

New wave Research 是美国 ESI 公司的分支部门，专业生产激光烧蚀进样系统。为 ICP-MS 或 ICP-OES 提供激光取、进样系统，使原来繁杂的样品制备过程变得极其简单快捷。常用于各种地质岩石、海洋矿物、物证鉴定等各种材料直接固体进样，进行微区分析、元素、同位素分析等。是目前全球最大的激光进样系统供应商。

UP193FX – 193nm 准分子激光烧蚀系统

- 超短脉宽、最小尺寸、结构紧凑的一体式 193nm 准分子激光烧蚀系统
- 高辉度系统, 样品表面辉度值 $>3\text{GW}/\text{cm}^2$, 能量密度 $>12\text{J}/\text{cm}^2$
- 脉冲宽度 $<4\text{ns}$, 同类型系统中脉宽最短
- 风冷, 脉冲频率 1-100Hz 可调
- 烧蚀坑尺寸范围 2 μm -150 μm , 具有最佳的光斑平整度
- 气体换气消耗量不超过 2 升
- 是锆石、包裹体等研究的最佳工具



UP213 – 213nm 固体激光烧蚀系统

- Nd:YAG五倍频深紫外 (213nm) 激光烧蚀进样系统, 适用透明和不透明的材料
- 能量密度高达 $30\text{J}/\text{cm}^2$, 0-20Hz 激光脉冲重复频率
- 烧蚀坑尺寸范围宽 2 μm -250 μm , 13 种尺寸选择
- 小到 2 微米的微区分析, 针对流体包裹体、石英、岩盐、化石等
- 领先的激光烧蚀操作软件, 带有和世界主流的 ICP 仪器的接口
- 适用于地质学、海洋学、法医罪证鉴定、半导体、生医、环境监测的样品分析。

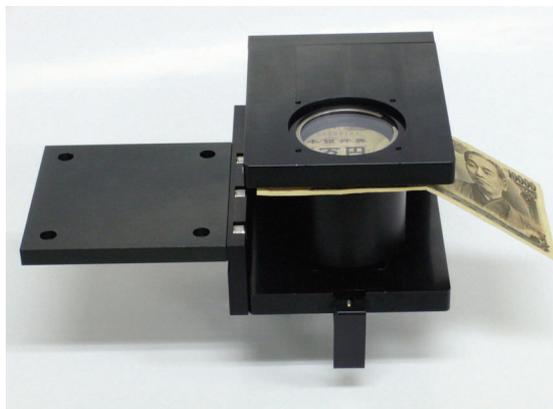
UP266MACRO – 266nm 固体激光大光斑烧蚀系统

- Nd:YAG四倍频(266nm)激光烧蚀系统, 特别为所有紫外穿透的样品材料而设计
- 能量密度高于 $15\text{J}/\text{cm}^2$ ($5\text{GW}/\text{cm}^2$), 能有效烧蚀钢铁、贵金属、塑料、陶瓷、生医材料和部分玻璃等
- 12 档预校准的烧蚀坑尺寸为 30 μm -750 μm 。包括有 VERI 更大更小尺寸光斑扩展到 20 μm -1100 μm
- 大量的烧蚀量适用于 ICP-OES 分析
- 系统软件可以控制所有的激光参数、样品显示和移动台位置等功能, 以及特有的样品导航功能、数字字母标记等功能



适合多种应用的激光烧蚀样品室

WaferCell™/PaperCell™

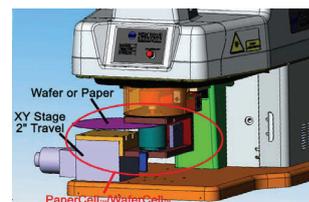


■ 文件/晶片样品室

适用于纸张、晶片、薄片等样品分析，直接烧蚀进样不需破坏样品。应用于司法鉴定、考古学、半导体材料分析等领域。

- 样品厚度<0.8mm
- 金属薄板、半导体晶片
- 纸、纸币、证券、合同、艺术品等
- 快速安装<5分钟

P/N 0020-8659-1 (UP193FX, UP213, UP266)



LFC™



■ 高灵敏度的超大型样品室

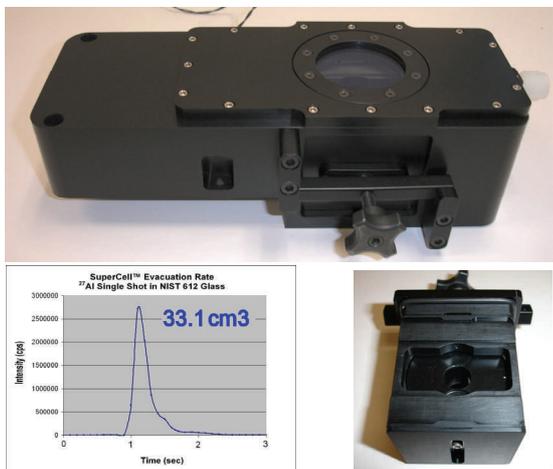
超大工作面积而不损失灵敏度，信号强度比标准样品室更高。可以同时放置多个样品，实现全自动进样分析，大大提高分析效率。

- 内部体积: 15 x 15 x 2.5(深) (cm)
- 更高的气溶胶传输效率，冲洗时间<3s
- 提高信号稳定度达90%以上，RSD接近1%
- 可在实验室现场安装
- 配置完全自动化移动台，电源: 110-240V

PN: 0020-2913(UP213)

PN: 0020-2996(UP193FX)

SuperCell™



■ 快速响应的高灵敏度样品室

大工作面积，高灵敏度，特别适用于岩石薄片、二维电泳凝胶和其他切片材料分析。

- 减少气溶胶分散，提气溶胶高浓度，从而提高信噪比和检测限
- 快速冲洗，提高信号稳定度，减少记忆效应，提高采样速度
- 在18.5cm²大的工作面积上实现均一信号响应
- 快速安装<5分钟，不需要停止ICP-MS

PN: 0020-0263(UP266)

PN: 0020-0266(UP213)

PN: 0020-1370(UP193FX)

